

富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ 半導体材料「CMP スラリー」の新生産ラインを稼働

台湾での現地生産を開始し、顧客ニーズへ迅速に対応！

平成 24 年 8 月 30 日

富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社(社長:御林 慶司、以下、FFEM)は、台湾の半導体材料の生産・販売子会社である FUJIFILM Electronic Materials Taiwan Co., Ltd.(以下、FETW)において、CMP スラリー^{※1}の新生産ラインを 8 月より稼働させ、台湾での現地生産を開始しました。

FFEM は、富士フイルムの重点事業の 1 つである「エレクトロニクスマテリアルズ事業」の中核会社で、半導体製造工程に使用するフォトレジスト^{※2}やイメージセンサー用材料^{※3}、CMP スラリーなどを生産し、ワールドワイドに提供しています。

FFEM は、アジアの半導体生産の主要拠点として急成長している台湾に、平成 8 年に FETW を設立。FETW をアジア市場に向けた中核生産拠点の 1 つと位置付け、設立当初からフォトレジストおよび現像液などを、平成 14 年からはイメージセンサー用材料を生産し、顧客の現地生産化ニーズに対応してきました。

さらに今回、FETW に CMP スラリーの新生産ラインを導入し、現地生産をスタートさせました。顧客サポート力の強化やデリバリーの短納期化を図り、顧客満足度をさらに向上させていくとともに、今後も伸張が予測されている CMP スラリーの需要に応えていきます。

これまでの CMP スラリーの生産拠点である米国の FUJIFILM Planar Solutions, LLC^{※4}に、FETW を加えた 2 生産拠点体制の構築により、生産のリスク分散を行い、CMP スラリーの安定供給を行っていきます。

FFEM は、半導体用感光材料であるフォトレジストの製造販売会社として昭和 58 年に設立以来、高機能フォトレジスト製品を次々に市場投入するとともに、現像液などの関連処理剤やイメージセンサー用材料などさまざまな特色ある電子材料製品を提供し、事業を拡大していきました。今後も、半導体製造に役立つ製品を提供し、電子産業の発展に貢献していきます。

※1 Chemical Mechanical Polishing(化学的機械研磨)の略。CMP スラリーとは、半導体の製造プロセスで使用されるウエハーを平坦化するための研磨剤。

※2 半導体製造の前工程で、回路パターンの描画を行う際にウエハー上に塗布する材料。

※3 デジタルカメラや携帯電話に用いられる CCD や CMOS センサーなどのイメージセンサーのカラーフィルターを製造するための着色感光材料製品。

※4 米国会社の FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Inc.の子会社。

<新生産ラインの概要>

1. 会社名	FUJIFILM Electronic Materials Taiwan Co., Ltd.
2. 所在地	30, Kuang-fu N. Rd. Hsin-chu Ind. Park Hu-Kou Xiang, Hsin-chu County, 303 Taiwan
3. 生産品目	半導体材料「CMP スラリー」
4. 稼働開始時期	平成 24 年 8 月

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

(報道関係) 富士フイルム株式会社 広報部 TEL 03-6271-2000

(お客様) 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 経営企画部 TEL 03-3406-6689

インターネットホームページアドレス

<http://ffem.fujifilm.co.jp/>